## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 特 許 公 報 (B2)

(11)特許番号

# 第2547021号

(45)発行日 平成8年(1996)10月23日

(24)登録日 平成8年(1996)8月8日

(21) 出膜番号 **	<b>持顧昭62-146824</b>		(73)特許權者	99999999	ा . च्यां	<u> </u>
					発明の数1(全	8 頁)
G 0 2 B 6/44	3 0 1		G02B 6	/44	301A	
C03C 25/02			CO3C 25	02	В	
C 0 8 F 290/06	MRX		COSF 290/	<b>'06</b>	MRX	
(51) Int.Cl. <sup>8</sup>	識別記号	庁内整理番号	FΙ		技術	校不凿所

(21)出腺番号	<b>特顧昭62-146824</b>	(73)特許權者	99999999
			ディーエスエム・エヌヴィ
(22)出顧日	昭和62年(1987) 6 月12日		オランダ国,ティーイー・ヘエルレン
			6411、ヘト・オーパールーン 1
(65)公開番号	特開昭63-312310	(73)特許権者	99999999
(43)公開日	昭和63年(1988)12月20日		日本合成ゴム株式会社
			東京都中央区築地2丁目11番24号
		(72)発明者	大高 亨
			東京都中央区築地2丁目11番24号 日本
			合成ゴム株式会社内
		(72)発明者	別所 啓一
		,	東京都中央区築地2丁目11番24号 日本
			合成ゴム株式会社内
		(74)代理人	弁理士 岩見谷 周志
		審査官	藤井 彰

#### (54)【発明の名称】 光ファイバー被覆材料

1

## (57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】 (a) 分子末端にモノエチレン性不飽和基を有する数平均分子量2,000~10,000のポリウレタン60~85重量%

(b) エステル構造のアルコール残基中に炭素原子数7 以上の非環式基を有し、そのホモポリマーのガラス転移\* 2

最終頁に続く

\*温度が-10~-80℃である(メタ)アクリレート化合物 〔ただし、下記式:

および

$$CH_{2} = CH - C - O(CH_{2})_{5} - C - OCH_{2}$$

(式中、R<sup>1</sup>は水素原子またはメチル基であり、 q は 8 ~ 20の整数である)

で表される(メタ)アクリレート化合物を除く〕10~39 重量%

ならびに

(c) 重合開始剤0.1~10重量%

を含有してなり、

(a) 成分の総量の50~95重量%がプロピレンオキシド およびテトラヒドロフランを重量比(プロピレンオキシ ド:テトラヒドロフラン) 10:90~50:50の割合で開環共 3

重合させた構造である光ファイバー被覆材料。

#### 【発明の詳細な説明】

### [産業上の利用分野]

本発明は、光ファイバー被覆材料として好適である液 状硬化性樹脂組成物に関する。

## [従来の技術]

光ファイバーに用いられるガラスファイバーは脆く損傷し易いので保護、補強のために樹脂被覆が施されている。光ファイバーの製造においてこの樹脂被覆の形成は、ガラスフィイバーの熱溶融紡糸直後に行なわれるの 10で、用いられる光ファイバー被覆材料には、常温で液状であって作業性が高いこと、硬化速度が高く生産性が良好であること等が要求される。

また、光ファイバーは多様な環境下で使用されるため、低温(例えばー40℃)から高温(例えば60℃)の広い温度範囲において伝送損失が小さいことが要求されるが、低温下では一般に被覆材料のヤング率が増加して光ファイバーに圧縮応力が加わる結果伝送損失が増大することが知られている。

これらの要求に対し、従来、硬化速度の大きい放射線 硬化型の液状被覆材料が種々提案され(例えば特開昭58 -223638号公報)ているが、低温下においてヤング率が なお高いという問題を有している。そこで低温下におい ても低いヤング率を有する光ファイバー被覆材料として 可塑剤を配合したものが知られている(特開昭60-1811 70号公報)。

[発明が解決しようとする問題点]

\* しかし、前配特開昭60-181170号公報に配載の可塑剤 を含む被覆材料は、ガラスファイバーに対する密着性が 低いため保護、補強が不十分であり、高温下においては 可塑剤が被覆から分離するという問題を有する。

一方、光ファイバーをその末端で接続する際には被覆を一部剥離する必要があるので、被覆材料にはガラスファイバーからの適度の剥離性も求められるため、ガラスファイバーに対する密着性と剥離性とのバランスが良好な樹脂被覆を形成することができる被覆材料が求められる。

そこで、本発明の目的は、低温下においてもヤング率 が低く、ガラスファイバーに対し適度の密着性と適度の 剥離性を示す光ファイバー被覆材料を提供することにあ る。

# [問題点を解決するための手段] 本発明は、

- (a) 分子末端にモノエチレン性不飽和基を有する数 平均分子量2,000~10,000のポリウレタン60~85重量%
- (b) エステル構造のアルコール残基中に炭素原子数 7以上の非環式基を有し、そのホモポリマーのガラス転 移温度が-10~-80℃である(メタ)アクリレート化合 物[ただし、下記式:

$$CH_{2} = C - C_{q} - C_{q} H_{2q+1}$$
 $R^{1} = 0$ 

および

(式中、R<sup>1</sup>は水素原子またはメチル基であり、 q は 8 ~ 20の整数である) で表される (メタ) アクリレート化合物を除く] 10~39重量%ならびに

- (c) 重合開始剤0.1~10重量% を含有してなり、
- (a) 成分の総量の50~95重量%がプロピレンオキシドおよびテトラヒドロフランを重量比(プロピレンオキシド:テトラヒドロフラン)10:90~50:50の割合で開環共重合させた構造(以下、「共重合体構造」と称す)である光ファイバー被覆材料を提供するのである。

本発明の組成物に用いられる(a)成分のポリウレタンは、共重合体構造を(a)成分の総量の50~95重量%含むことが必要であり、好ましくは60~95重量%、特に好ましくは80~95重量%である。この割合が50重量%未満であると、得られる組成物の保存安定性が低下し固形物が析出し易くなり、また組成物の硬化物の低温におけるヤング率が増加する。

本発明において(a)成分のポリマーは、数平均分子 量が2,000~10,000であり、好ましくは3,000~8,000で ある。

数平均分子量が2000未満であると、硬化物の低温におけるヤング率が上昇し低温での光ファイバーの伝送損失が増加する。一方、数平均分子量が10000を越えると組成物の粘度が上昇し、光ファイバーに組成物を被覆する際の塗工性が悪化するので好ましくない。

- (a) 成分のポリマーの本発明の組成物中に占める割合は60~85重量%、好ましくは、60~80重量%、特に好ましくは60~75重量%である。(a) 成分の組成物中に占める割合が60重量%未満であると組成物の硬化性が悪化し、また光ファイバーの被覆材料として用いた場合に被覆のガラスファイバーに対する密着性および機械的強度が低下する。一方、この場合が85重量%を越えると組成物の粘度が上昇してガラスファイバーへの塗工性が悪化するとともに、得られる被覆のガラスファイバーからの剥離性が悪くなる。
- (a) 成分のポリマーの製造は、例えば前記共重合体 構造を有するジオールと、ジイソシアネートとを反応さ 50 せて得られる、イソシアネート基を有しウレタン結合に

5

よって結合された重合体のイソシアネート基に、水酸基 を有する(メタ)アクリル系化合物を反応させることに より行なうことができる。

上記製法に用いられる、前記共重合体構造を有するジオールは、プロピレンオキシドおよびテトラヒドロフランを所望の割合で混合物を公知の方法により開環共重合させることにより製造することができ、また、例えばPP TG4000 (保土ヶ谷化学 (株) 製)、PPTG2000 (同)、ユニセーフDC1800 (日本油脂 (株))等の商品名で入手することができる。

上記製法に用いられるジイソシアネートとしては、2, 4ートリエンジイソシアネート、2,6ートリエンジイソシ アネート、1,3ーキシレンジイソシアネート、1,4ーキシ レンジイソシアネート、1,5ーナフタレンジイソシアネ \* \*ート、oーフェニレンジイソシアネート、pーフェニレンジイソシアネート、3,3' ージメチルー4,4' ージフェニルメタンジイソシアネート、4,4' ージフェニルメタンジイソシアネート、3,3' ージメチルフェニレンジイソシアネート、4,4' ーピフェニレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、イソフォロンジイソシアネート、メチレンピス(4 ーシクロヘキシルイソシアネート)等が挙げられる。

水酸基を有する(メタ)アクリル系化合物としては、
10 例えば2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシオクチル(メタ)アクリレート、ならびに下配の一般式(I)または(II)で表わされる化合物を挙げることができる。

$$CH_{z} = C(R^{1}) - C - 0 - CH_{z}CHCH_{z}O \longrightarrow (I)$$

(ここで、R<sup>1</sup>は水素原子またはメチル基である) 20

(ここで、 $R^1$ は前記のとおりであり、nは $1\sim5$ の整数である)

上記の製造を実施する際には、前記共重合体構造が (a) 成分の総量の50~95重量%となる範囲であれば、必要に応じて前記共重合体構造を有しないジオールを併用することができる。そのようなジオールとしては、例えば、前記共重合体構造を有しないポリエーテルジオール、ポリエステルジオール、ポリカーボネートジオール、ポリカプロラクタムジオール等を挙げることができる。

前記共重合体構造を有しないポリエーテルジオールとしては、例えば、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリテトラメチレングリコール等が挙げられ、さらに水酸基を1分子中に2個有する液状ポリブタジエンまたはこの化合物の水添物等を挙げることができる。ポリエステルジオールとしては、例えばエチレングリコール、ポリプロピレグリコール、プロピレングリコール、ポリプロピレグリコール、テトラメチレングリコール、ポリテトラメチレングリコール、1,6-ヘキサンジオール、ネオペンチルグリコール、1,4-シクロヘキサンジメタノール等の多価アルコールとフタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、マレイン酸、フマール酸、アジピン酸、セバシン酸等の多塩基酸とを反応して得られるポリエステルジオールが挙げられる。

ポリカーボネートジオールとしては、日本ポリウレタン社製DN-980,DN-981,DN-982,DN-983,米国PPG社製PC-8000等が挙げられる。

30 また、ポリカプロラクトンジオールとしては、εーカ プロラクトンと、エチレングリコール、ポリエチレング リコール、ポリプロピレングリコール、テトラメチレン グリコール、ポリテトラメチレングリコール、1,6ーへ キサンジオール、ネオペンチルグリコール、1,4ーシク ロヘキサンジメタノール、1,4ーブタンジオール等の2 価のジオールとを反応させて得られるポリカプロラクトンジオールが挙げられる。

次に、前記の製法の好ましい実施態様を示す。前記共 重合体構造を有するジオールの水酸基1当量あたりのジ 0 イソシアネート化合物の使用量は、約0.5~2モルであ る。この反応においては、通常、ナフテン酸銅、ナフテ ン酸コバルト、ナフテン酸亜鉛、ラウリル酸 n − ブチル スズ、トリエチルアミン等の触媒を反応物の総量100重 量部に対して0.01~1重量部用いて反応を行う。この反 応における反応温度は、30~80℃である。

このようにして得られる中間生成物のイソシアネート 基に対して水酸基を有する(メタ)アクリル系化合物を 反応させるが、水酸基を有する(メタ)アクリル系化合 物の使用量は、該中間生成物のイソシアネート基1当量 50 に対して約0.5~2モルであり、その反応条件は、前記

の中間生成物をつくる反応条件と同様である。

本発明の組成物に用いられる(b)成分の(メタ)ア クリレート化合物は、エステル構造のアルコール残基中 に炭素数原子数7以上、好ましくは10~100で、非環式 の1価または2価の基(以下、「非環式基」という)を 有するものである。この炭素数原子数が7未満である と、硬化物の低温におけるヤング率が増加する。この非 環式基は、その構造中にエーテル結合、エステル結合、 アミド結合、チオエーテル結合、スルフォキシド結合、 アミノ基等を含有していてもよく、例えば、

## 式:

## $+R^20$

[ここで、 $R^2$ は炭素原子数  $2 \sim 6$ のアルキレン基であ り、mは3~16の整数である〕 で表わされるポリエーテル構造を有する基 式:

\* [ここで、 $R^3$ および $R^4$ は各々炭素原子数2~7のアルキ レン基であり、pは1~15の整数である] で表されるポリエステル構造を有する基等が挙げられ

さらに (b) 成分の (メタ) アクリレート化合物には 環式基も含まれることが好ましい。

また、(b)成分の(メタ)アクリレート化合物は、 (メタ) アクリル酸残基部分に存在する二重結合の重合 によりホモポリマーを製造した場合に、そのホモポリマ 10 ーのガラス転移温度が-10~-80℃、好ましくは-20~ -70℃となるものである。ホモポリマーのガラス転移温 度が-10℃を越えると、硬化物の低温におけるヤング率 を増加させ、また、-80℃未満であると、硬化物の機械 的強度が低下する。

このような (b) 成分の (メタ) アクリレート化合物 の分子量は、通常、200~3,000程度の範囲である。

(b) 成分の(メタ) アクリレート化合物の具体例と しては、下記の式で表わされる化合物を挙げることがで きる。

$$CH_{z}=C(R^{1})-C-O(R^{2}O)_{m}$$
(I)

[ここで、m, $R^1$ および $R^2$ は前記のとおりで、 $R^5$ は水素原※ ※子または炭素原子数  $1 \sim 12$ のアルキル基である。〕

$$CH_{z} = C(R^{1}) - C(0 - R^{3} - C)_{p}0 - CH_{z}$$

[ここで、R<sup>1</sup>,R<sup>3</sup>および p は前記のとおりである]

$$CH_{z}=C(R^{1})-C+OR^{3}-C+\frac{1}{P}O-CH_{z}-C-CH$$

$$CH_{3}O-CH_{z}-C-CH$$

$$CH_{3}O-CH_{z}-C-CH$$

$$CH_{3}O-CH_{z}-C-CH$$

$$CH_{3}O-CH_{z}-C-CH$$

$$R^{5}$$

$$R^{5}$$

[ここで、 $R^1$ , $R^2$ およびpは前記のとおりであり、 $R^5$ は 水素原子またはメチル基である〕、

- (b) 成分の(メタ) アクリレート化合物は一種単独 で使用することができるが、2種以上使用することが硬 化速度を向上させる上で好ましい。
- (b) 成分の(メタ) アクリレート化合物の本発明の 組成物中の割合は、10~39重量%であり、特に20~39重 量%が好ましい。この(b)成分の割合が10重量%未満 であると、得られる硬化物の低温におけるヤング率が上 昇し光ファイバーへ適用した際に伝送損失が増加し、ま 50 ミノベンゾフェノン、ミヒラーケトン、ベンゾインプロ

た39重量%を越えると組成物の硬化性が低下する。

本発明の組成物に用いられる(c)成分としての光重 合開始剤としては、例えば、1-ヒドロキシシクロヘキ シルフェニルケトン、2,2-ジメトキシー2-フェニル アセトフェノン、アセトフェノン、ベンゾフェノン、キ サントン、フルオレノン、ベンズアルデヒド、フルオレ ン、アントラキノン、トリフェニルアミン、カルバゾー ル、3-メチルアセトフェノン、4-クロロベンゾフェ ノン、4,4′ージメトキシベンゾフェノン、4,4′ージア

9

ピルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンジルシメチルケタール、1-(4-4)プロピルフェニル)-2-ヒドロキシ-2-メチルプロパン-1-オン、2-ヒドロキシ-2-メチル-1-フェニルプロパン-1-オン、チオキサントン系化合物、2-メチル-1-[4-(メチルチオ)フェニル]-2-モルホリノープロパン-1-オン、2,4,6-トリメチルベンゾイルジフェニルーフォスフィンオキサイド等を挙げることができる。

本発明の組成物に使用される(c)成分としての熱重合開始剤も特に限定されず、種々のものを使用すること 10ができ、例えば過酸化物、アゾ化合物を挙げることができ、具体例としては、ベンゾイルパーオキサイド、tーブチルパーオキシベンゾエート、アゾビスイソブチロニトリル等を挙げることができる。

これらの重合開始剤は1種または2種以上を組合せて 用いられ、また光重合開始剤を用いる場合には、必要に 応じてアミン系化合物等の増感剤(重合促進剤)が併用 される。

これらの重合開始剤は、本発明の組成物に0.1~10重量%の範囲で配合される。

本発明の組成物には、前配(a)~(c)成分のほかに、必要に応じて(b)成分以外の反応性希釈剤、老化防止剤、重合禁止剤、レベリング剤、界面活性剤、シランカップリング剤等を配合することができる。

(b) 成分以外の反応性希釈剤としては、例えば、2 ーヒドロキシエチルアクリレート、2ーヒドロキシプロ ピルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレー ト、ブトキシエチルアクリレート、エチルジエチレング リコールアクリレート、2-エチルヘキシルアクリレー ト、シクロヘキシルアクリレート、フェノキシエチルア クリレート、ジシクロペンタジエンアクリレート、ポリ エチレングリコールアクリレート、ポリプロピレングリ コールアクリレート、メチルトリエチレングリコールア クリレート、ジエチルアミンエチルアクリレート、ジメ チルアミノエチルアクリレート、7ーアミノー3,7ージ メチルオクチルアクリレート、アクリロイルモルホリ ン、イソボルニルアクリレート、2-ヒドロキシエチル メタクリレート、2-ヒドロキシプロピルメタクリレー ト、ポリプロピレングリコールメタクリレート、ジエチ ルアミノエチルメタクリレート、トリメチロールプロパ 40 ントリアクリレート、エチレグリコールジアクリレー \*

\*ト、テトラエチレングリコールジアクリレート、ポリエチレングリコールジアクリレート、1,4ーブタンジオールジアクリレート、1,6ーへキサンジオールアクリレート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、トリメチロールプロパントリオキシエチルアクリレート、トリメチロールプロパントリオキシプロピルアクリレート、ビニルピロリドン、ビニルフェノール、アクリルアミド、酢酸ビニル、ビニルエーテル、ステレン、ジメチルアクリルアミド、ジエチルアクリルアミド、ビニルカプロラクタム、N,Nージメチルアミノプロピルアクリルアミド、オクチルアクリルアミド等を挙げることができる。

10

このようにして調製される本発明の組成物の粘度は、通常、1000~2000cp/25℃、好ましくは2000~10000cp/25℃であり、硬化後のヤング率は、-40℃~60℃において、通常、0.01~0.7kg/mm²の範囲にある。

#### [実施例]

以下に本発明の実施例により具体的に説明する。なお、以下において、部は重量部を意味する。

また、本発明においては、ホモポリマーのガラス転移 20 温度は以下の様にして測定した。

モノマー95部にベンジルジメチルケタール5部を溶解したものをガラス板上に厚さが200μになるように塗布した後合計照射エネルギーが1J/cm<sup>2</sup>に相当する紫外線をメタルハライドランプを用いて照射し硬化物を得、この硬化物のガラス転移温度をDSC 2℃/minで測定。 実施例1

撹拌機を備えた反応容器に、2,4ートリレンジイソシアナート81g、ジブチル錫ジラウレート1gおよび重合禁止剤として2,6ージtーブチルー4ーメチルフェノール1gを仕込んだ。これに数平均分子量3700のポリオキシプロピレングリコールーポリオキシテトラメチレングリコール、ランダム共重合体(保土ヶ谷化学社製、商品名PPTG4000)861gを、2時間にわたって内温を40~50℃にコントロールしながら添加した。添加終了後、更に1時間40~50℃で撹拌を継続した。その後、57gのヒドロキシエチルアクリレートを内温を40~50℃に保持したまま添加し、(a)成分である数平均分子量約4300のポリマー(A-1)を得た。

ついで、ポリマー(A-1)65部に(b)成分として、 式:

(ここで、mは平均値として4である) で表わされるアクリレート化合物(東亜合成化学社製。 商品名アロニックス113、ホモポリマーのガラス転移温 度-42℃)25部、および式: CH = CH - C + O - CH = CH = CH = CH = CH = CH = - C - O - CH =

(ここで、pは平均値として1である)

で表わされるアクリレート化合物(日本化薬社製、商品 名KAYARAD TC 110S、ホモポリマーのガラス転移温度-6 5℃) 10部、ならびにベンジルジメチルケタール5部を4 0~50℃で撹拌混合し、粘度が8500cp/25℃の組成物を得\*10

\*た。

#### 実施例2

(b) 成分として、アロニックスM 113の代りに、 式:

12

$$\begin{array}{c} O \\ II \\ CH_{z}=CH-C + O - CH_{z}CH_{z}CH_{z}CH_{z}CH_{z}-C + O - CH_{z} - CH_{z} \\ II \\ O \\ CH_{3} \\ O - CH_{2} \\ CH_{3} \\ O - CH_{2} \\ CH_{3} \\ O - CH_{2} \\ CH_{3} \\ O - CH_{3} \\ CH_{3} \\ O - CH_{4} \\ CH_{3} \\ CH_{3} \\ O - CH_{5} \\ CH_{3} \\ CH_{4} \\ CH_{5} \\ CH_{5$$

(ここで、pは平均値として2である)

で表わされるアクリレート化合物(日本化薬社製、商品 名KAYARAD R-629、ホモポリマーのガラス転移温度-38 ℃) 25部を使用した以外は、実施例1と同様にして、粘 度9,800cp/25℃の組成物を得た。

#### 比較例1

撹拌機を備えた反応容器に、2,4-トリレンジイソシ アナート97g、ジブチル錫ジラウレート1g、2,6-ジーt ーブチルー4ーメチルフェノールlgを仕込んだ。これに 数平均分子量3000のポリテトラメチレングリコール(三 菱化成工業社製, 商品名PTMG 3000) 835gを約2時間に わたって内温を40~50℃にコントロールしながら添加し た。添加終了後、更に、1時間、40~50℃で撹拌を継続 した。その後、65gのヒドロキシエチルアクリレートを 内温を40~50℃に保持したまま添加し数平均分子量約36 00のポリマー(B)を得た。

次いで、ポリマー (A-1) の代りにポリマー (B) を65部用いた以外は、実施例1と同様にして粘度が1200 0cp/25℃の組成物を得た。

#### 実施例3

ポリマー (A-1) 65部の代りに、ポリマー (A-1) 45部とポリマー (B) 20部を用いた以外は、実施例 1と同様にして粘度が9200cp/25℃の組成物を得た。 比較例2

アロニックスM113の代りにフェノキシエチルアクリレ ート(ホモポリマーのガラス転移温度15℃)25部を用い た以外は、実施例1と同様にして粘度が3500cp/25℃の 組成物を得た。

#### 試 験

前記実施例および比較例で調製した組成物の特性を次 のようにして評価した。結果を第1表に示す。

#### (1) ヤング率

組成物をガラス板上に、0.2㎜の厚みに塗工した後、 その上から合計照射エネルギーが1J/cm<sup>2</sup>に相当する紫外 線をメタルハライドランプを用いて照射し、得られた硬 50

化フィルムを幅6mmの短冊状に切断し、試験長25mmでJIS K6911に基づく引張試験法で、−50℃および23℃におけ る硬化フィルムのヤング率を測定した。

#### (2) 保存安定性

組成物を、温度を5℃に設定した恒温槽に10日間放置 20 後、結晶の析出も失透現象も認められない場合を可と評 価し、いずれか一方でも認められた場合を不可と評価し た。

#### (3)密 着性

組成物を石英板上に硬化後の厚さ0.2mmとなるように 途布した後、その上に合計照射エネルギーが1J/cm<sup>2</sup>に相 当する紫外線をメタルハライドランプを用いて照射し、 硬化皮膜を得た。

石英板上の皮膜を幅1cmのテープ状に石英板上に残し 硬化皮膜の一端を石英板に対して垂直方向に引張って剥 離させ、剥離に要する力を測定しその平均値を硬化皮膜 の石英板に対する密着性として評価した。

### (4)剥離性

光ファイバー線引装置を用いて石英棒を2000℃に加熱 し、線引速度60m/minで線引作業を行ない、径125 μの石 英ファイバーを製造し、次に組成物を線引直後のファイ バーに塗布し、出力3kWの紫外線ランプにより、紫外線 を照射して、硬化させた。

被覆材料は、完全に硬化しており平均膜厚80 µmの均 一な皮膜を得た。

このようして製造した被覆ファイバーを図1に示す装 置を用い、被覆ファイバー試料1の2箇所に円筒状の治 具2,2'を瞬間接着剤3で固定し、治具2,2'をそれぞれ 装置のあご4,4′に固定し、上のあご4を引張速度50mm/ minで引上げて引張試験を行なった。測定される力ー伸 びは図2に例示するパターンの曲線を描く。被覆層破断 直後の被覆層/ガラス界の摩擦力は図2に示される曲線 のプラトー部分として求められる。これを剥離性の指標 とした。

=

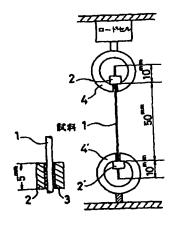
1

		実施例 1	実施例 2	実施例3	比較例 1	比較例 2
組成	ポリマーA-1	65	65	45	_	65
	ポリマーB	_	_	20	65	_
	【全ポリマー中に占める共重合体構造の割合】	86%	86%	60%	0%	
	アロニックスM113	25		25	25	
	KAYARAD TC110S	10	10	10	10	10
	KAYARAD R629		25			
	フェノキシエチルアクリレート					25
	ベンジルジメチルケタール	5	5	5	5	
特性	ヤング率23°C(kg/ml)	0,15	0.15	0,20	0.23	0,25
	—50°C(kg∕m²)	0,30	0.45	0, 53	0.63	25.0
	保存安定性	可	可	可	不可	可
	密着性(g)	3,0	3, 2	2,5	0.8	7.0
	新離性(g)	7	7	6	5	3.0

# (発明の効果)

本発明の光ファイバー被覆材料は、硬化性、保存安定性、塗工等の作業性に優れており、また硬化により得られる硬化物は耐熱性、耐加水分解性等に優れたものである。特に、低温~常温においてヤング率が小さいことから光ファイバーの伝送損失が広い温度範囲において小さいとともに、ガラスファイバーとの間に適度の密着性と

【第1図】



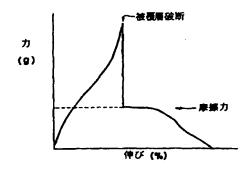
剥離性を示し、光ファイバー被覆材料として優れたもの である。

## 【図面の簡単な説明】

図1は、実施例において被覆の剥離性測定に用いた治 具。

図2は、実施例における被覆の剥離性測定試験における摩擦力測定の説明図。

【第2図】



## フロントページの続き

. . . .

(72)発明者 ブライアン ハンラハン (72)発明者 五十嵐 勝利 アメリカ合衆国, イリノイ州 60195, 東京都中央区築地2丁目11番24号 日本 シアウムブルク, エー・ピー・ティー・ 合成ゴム株式会社内 2-0, イー・アルゴンキアン ロード (72) 発明者 布施 和雄 1304 東京都中央区築地2丁目11番24号 日本 合成ゴム株式会社内 (56)参考文献 特開 昭63-130609 (JP, A) クライヴ・コウデイ (72)発明者

アメリカ合衆国, イリノイ州 60195,特開 昭63-130608 (J P, A)ハノーバー・パーク, ピクター・レイン特開 昭63-109699 (J P, A)1875